

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成21年9月10日(2009.9.10)

【公表番号】特表2009-504910(P2009-504910A)

【公表日】平成21年2月5日(2009.2.5)

【年通号数】公開・登録公報2009-005

【出願番号】特願2008-526063(P2008-526063)

【国際特許分類】

C 23 C 28/00 (2006.01)

B 82 B 3/00 (2006.01)

B 82 B 1/00 (2006.01)

【F I】

C 23 C 28/00 A

B 82 B 3/00

B 82 B 1/00

【手続補正書】

【提出日】平成21年7月22日(2009.7.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電気めっき法で形成されたナノスケール・トポグラフィーを含む、ナノ構造表面領域を有するパターン化ナノ構造表面を持つツールを準備すること；

前記ツールのパターン化ナノ構造表面を基材に複製し、基材のナノ構造表面領域を有する基材のパターン化ナノ構造表面を形成すること；

金属層を基材のパターン化ナノ構造表面に配置し、金属のナノ構造表面領域を有する金属のパターン化ナノ構造表面を形成すること；

金属のナノ構造表面領域を含む、金属のパターン化ナノ構造表面上に自己組織化単一層を形成すること；

被覆金属を含有する無電解めっき溶液に自己組織化単一層を暴露すること；

及び、金属のナノ構造表面領域上に選択的に被覆金属を無電解めっきで堆積させること、を含む方法。

【請求項2】

電気めっき法で形成されたナノスケール・トポグラフィーを含む、ナノ構造化表面領域を有するパターン化ナノ構造表面を持つツールを準備すること；

基材の金属表面にツールでパターン化ナノ構造表面をエンボス加工し、金属のナノ構造表面領域を有する、基材の金属パターン化ナノ構造表面を形成すること；

金属のナノ構造表面領域を含む、基材の金属パターン化ナノ構造表面上に自己組織化単一層を形成すること；

被覆金属を含む無電解めっき溶液へ自己組織化単一層を暴露すること；及び

金属のナノ構造表面領域上に被覆金属を選択的に無電解めっきで堆積させること、を含む方法。

【請求項3】

ナノスケール・トポグラフィー形状を有する線状痕跡の領域を持つ基材表面を有し、該領域の平均幅が1～50マイクロメートルの範囲にあり、ナノスケール・トポグラフィー

形状の平均サイズが 10 ~ 500 ナノメートルの範囲にある基材、及び  
ナノスケール・トポグラフィー形状を持つ領域上に選択的に配置され、側面縁部の粗度  
が被覆金属の線状痕跡幅の 20 % 未満である線状の被覆金属痕跡を形成する被覆金属を含  
む物品。